

CHF₃/Ar 等离子体刻蚀BST 薄膜的机理研究

戴丽萍, 王姝娅, 束平, 钟志亲, 王刚, 张国俊

电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室, 成都 610054

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章 \(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org